

第 189 回ラドテック研究会講演会

期 日：2025 年 4 月 17 日（木） 10：00～16：40
会 場：大阪市中央公会堂 小会議室
主 催：一般社団法人ラドテック研究会
協 賛：一般社団法人近畿化学協会・一般社団法人色材協会・合成樹脂工業協会
一般社団法人日本接着学会・フォトポリマー懇話会
一般社団法人有機エレクトロニクス材料研究会（予定 順不同）

<プログラム>

敬称略

1) 10：00～11：30（質疑応答含む）

"Breaking the boundaries using non-conventional ways to improve the reactivity of photoinitiators "

Laboratoire de Photochimie et d'Ingénierie Macromoléculaires,
Université de Haute Alsace Prof. Xavier Allonas

2) 13：00～13：50（質疑応答含む）

「UV 硬化樹脂およびプラズマ表面処理状態の高速測定技術」

株式会社アクロエッジ 中宗 憲一

半導体産業では、UV 硬化樹脂やプラズマ処理の品質管理が不可欠であり、高速かつ高精度な評価技術が求められている。本講演では、歩留まり向上を目的とした、蛍光を用いた UV 硬化樹脂の硬化度およびプラズマ処理状態の測定技術について、その原理と最先端工場での応用事例を紹介する。

3) 13：50～14：40（質疑応答含む）

「UV インプリント技術および表示デバイス等への応用事例」

松浪硝子工業株式会社 石井一久

UV 硬化樹脂を用いて、ガラス基板の上にナノ・マイクロオーダーの樹脂微細構造を、高精度に形成する UV インプリント技術を紹介する。また、本技術を活用した表示デバイス等への応用事例を紹介する。

14：40～15：00 休憩

4) 15：00～15：50（質疑応答含む）

「半導体産業の動向と半導体用レジストの材料設計」

大阪公立大学 堀邊英夫

レジスト材料(感光性樹脂)・プロセスについて解説するとともに、元デバイスメーカーに席を置いた者の視線で、素材メーカーにおけるフォトレジスト評価法や半導体産業の動向についてもご紹介する。

5) 15：50～16：40（質疑応答含む）

「塩基発生反応が拓く高機能フォトポリマー」

東京理科大学 有光晃二

光塩基発生反応や連鎖的な熱塩基発生反応を駆使した「影部 UV 硬化」、「傾斜構造を有する有機-無機ハイブリッド膜の光作製」、および「Semi-IPN 構造形成による光パターニング」など、我々の最近の研究例を紹介する。

17：00～18：30 懇親会

※プログラムは変更になる場合がございます。